

могут быть описаны в пределах однослоиной модели с учетом дисперсии показателя преломления $N=n-ik$ подложки. Однако особенности, наблюдаемые в высокотемпературных режимах (рис. 2, кривые 4—6), требуют привлечения более сложных моделей, например варизонной области с рекомбинационными центрами и поверхностным слоем In_2O_3 , толщина которого превышает интерференционную.

В заключение отметим, что в пределах выбранных технологических режимов удается формировать гетероструктуры со слоем In_2O_3 , имеющим геометрическую толщину $30 \div 70$ нм и показатель преломления $n=2.12 \div 2.14$ ($k \approx 10^{-3}$), что приводит к просветлению гетероструктур в видимой области спектра, на которую приходится максимум интенсивности солнечного излучения.

Список литературы

- [1] Чопра К., Дас С. Тонкопленочные солнечные элементы. М., 1986. 440 с.
- [2] Медведкин Г. А., Амбрязивичюс Г. А., Яковенко А. А. // Поверхность. Физика, химия, механика. 1987. № 2. С. 81—87.
- [3] Медведкин Г. А., Бекимбетов Р. Н., Макарова Т. Л., Смирнова А. Д., Соколова В. И. // ЖТФ. 1987. Т. 57. В. 5. С. 960—964.
- [4] Kazmerski L. L., Hallerdt M., Ireland P. J., Mickelsen R. A., Chen W. S. // J. Vac. Sci. Techn. 1983. V. A1. N 2. P. 395—398.
- [5] Hollingsworth R. E., Sites J. R. // Proc. 18 IEEE Phot. Spec. Conf. N. Y., 1985. P. 1409—1412.
- [6] Колтун М. М. Селективные оптические поверхности преобразователей солнечной энергии. М., 1979. 215 с.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Получено 21.04.1988
Принято к печати 7.12.1988

ФТП, том 23, вып. 5, 1989

ЧАСТОТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ШИРИНЫ ЛИНИИ ЭПР В АМОРФНОМ КРЕМНИИ В ИНТЕРВАЛЕ $9 \div 130$ ГГц

Бугай А. А., Зарницкий И. М., Лукин С. Н.,
Неймарк Е. И., Кабдин Н. Н.

Оборванные ковалентные связи (D -центры) являются неотъемлемой частью аморфного состояния тетраэдрически координированных полупроводников. ЭПР спектроскопия D -центров дает важную информацию о микроструктуре областей их локализации. Это позволяет делать определенные выводы об особенностях формирования аморфного состояния и дефектообразовании, сопровождающем этот процесс [1-3].

В настоящей работе впервые проведено исследование ширины линии ЭПР (ΔH_{pp}) D -центров в кремнии, аморфизированном ионной имплантацией, в широком интервале частот регистрации $\nu=9 \div 130$ ГГц с целью выяснения вклада различных уширяющих механизмов в ΔH_{pp} и дальнейшей детализации особенностей дефектообразования в кремнии при ионной имплантации.

Исследовались образцы высокоомного кремния БМД-0.5Б, облученные ионами As^+ с энергией 100 кэВ и дозой $1.8 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$. Концентрация D -центров с g -фактором ($g=2.0055$) составляла в них $\sim 10^{20} \text{ см}^{-3}$. Измерения ΔH_{pp} выполнены с помощью трех спектрометров ЭПР на четырех частотах наблюдения: 9.4, 35, 72 и 130 ГГц. Было установлено, что ΔH_{pp} не зависит от T в интервале $4.2 \div 300$ К. Анализ формы линии ЭПР показал, что при $\nu=9.4$ и 35 ГГц она является лоренцианом, при $\nu=72$ ГГц — промежуточной между лоренцианом и гауссианом, при $\nu=130$ ГГц — близкой к гауссиану. Экспериментальные данные зависимости $\Delta H_{pp}(\nu)$ представлены на рисунке.

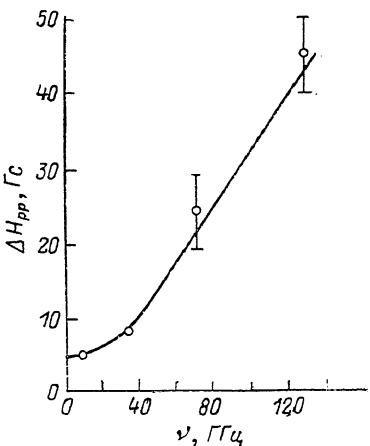
Наиболее интересной особенностью является нелинейность зависимости $\Delta H_{pp}(\nu)$ при $\nu < 35$ ГГц, указывающая на доминирование в этой области не зависящих от ν механизмов уширения, не связанных с разбросом g -фактора. Это означает, что для описания приведенных данных не применимо используемое, например, для $a\text{-Si : H}$ приближенное выражение вида [3]

$$\Delta H_{pp}^{(ij)} \simeq \Delta H_{pp}^{(ii)} + \frac{\nu_j}{\nu_i} \Delta H_{pp}^{(ii)}(g), \quad (1)$$

справедливое для лоренцевской формы линии и позволяющее элементарно выделить вклад в ΔH_{pp} от разброса g -фактора $\Delta H_{pp}(g)$ на частоте измерения ν , при переходе в более высокочастотный диапазон измерения с $\nu_j > \nu_i$.

Для описания экспериментальных данных воспользуемся кластерной моделью распределения оборванных связей [1], вводя следующие предположения:

- 1) в исследуемом материале имеются пространственно изолированные кластеры парамагнитных дефектов (D -центров), которые характеризуются лоренцевским распределением резонансных частот с шириной $\delta_{\text{л}}$, не зависящих от внешнего магнитного поля H ;
- 2) в пределах кластера имеется разброс g -факторов по гауссовскому закону,¹ приводящий к дополнительному неоднородному уширению $\delta_{\Delta g}$, линейно зависящему от H (Δg -механизм); другие уширяющие механизмы в пределах кластера [магнитный диполь-дипольный ($\delta_{\text{д-д}}$), сверхтон-



Частотная зависимость ширины линии ЭПР D -центров в кремни, аморфизированном понной имплантацией.

Сплошная линия — аппроксимация по формуле (3).

кий ($\delta_{\text{св}}$) с ядрами ^{29}Si и др.] приводят к остаточной «статической» ширине кластера; 3) результирующая ширина линии ЭПР кластера (ширина спин-пакета) формируется с учетом обменного взаимодействия D -центров в кластере, приводящего к усреднению статических механизмов уширения, указанных в п. 2, и не затрагивающего основного неоднородного уширения, указанного в п. 1. Эффективность обменного сужения по отношению к Δg -механизму существенно зависит от величины внешнего магнитного поля, что, как будет видно из дальнейшего расчета, и определяет нелинейность зависимости $\Delta H_{pp}(\nu)$ в области относительно низких частот (или резонансных полей) наблюдения.

Для случая произвольного значения обменного поля H_e форма и ширина спин-пакета были рассчитаны численно в соответствии с [4] с гауссовской случайной функцией корреляции. Результаты расчета с хорошей степенью точности удалось аппроксимировать следующим выражением:

$$\hat{\delta}_{pp} = \frac{\delta_{\text{л}}^2}{\delta_{pp} + H_e^*}, \quad (2)$$

где $\delta_{\text{л}}^2 \simeq \delta_{\Delta g}^2 + \delta_{\text{д-д}}^2 + \delta_{\text{св}}^2$, $\delta_{\Delta g} = b\nu$, δ_{pp} — ширина спин-пакета (между пиками производной линии ЭПР), $H_e^* = 3.46 H_e$, H_e — «истинное» обменное поле.

Результирующая форма линии ЭПР является сверткой формы обменно-суженного спин-пакета (2) с распределением разброса резонансных частот

¹ Разброс g -факторов возникает вследствие случайного разброса параметров гибридизации волновой функции D -центров, констант спин-орбитального взаимодействия и энергий связей [3].

клластеров. Ширина этой свертки, которая и является шириной наблюдаемой линии ЭПР, может быть аналогично [5] аппроксимирована в виде

$$\Delta H_{pp} \simeq \delta_a + \frac{\delta_{ct}^2}{\Delta H_{pp} + H_e^*}, \quad (3)$$

(3) переходит в известные формулы свертки двух лоренцианов при $H_e^* \gg \delta_{ct}$ и лоренциана с гауссианом при обратном соотношении.

На рисунке представлена аппроксимация экспериментальных данных с помощью (3) со следующими подгоночными параметрами: $\delta_a \simeq 5$ Гс, $H_e \simeq 9$ Гс, $b \simeq 0.4$ Гс/ГГц. Хорошее согласие с экспериментом свидетельствует в пользу кластерной модели распределения D-центров. Экспериментально наблюдаемое изменение формы линии с ростом v тоже согласуется с (3). Видно также, что нелинейность зависимости $\Delta H_{pp}(v)$ связана с изменением соотношения между H_e^* и $\delta_{ct} = bv$ с ростом v : $H_e^* \gg bv$ при $v \leq 35$ ГГц и $H_e^* \ll bv$ при $v \geq 70$ ГГц. Коэффициент b характеризует ширину распределения g-факторов в пределах кластера: $\Delta g \simeq bg^2 \mu_B/h \simeq 2 \cdot 10^{-3}$. Были оценены также вклады различных механизмов уширения в δ_{pp} при $v = 9.4$ ГГц: $\delta_{d-d}^2/H_e^* \simeq 1$ Гс, $\delta_{g-g}^2/H_e^* \simeq 0.5$ Гс, $\delta_{ctv}^2/H_e^* \simeq 0.2$ Гс. Результирующая ширина спин-пакета $\delta_{pp} \simeq 1.7$ Гс близка к измеренной в [1] методом непрерывного насыщения.

Представленные результаты являются независимым подтверждением кластерной модели [1] распределения оборванных связей в кремнии, аморфизированном ионной имплантацией, для которого, как и для a-Si, полученного методами радиочастотного распыления или испарения, характерно сосуществование высокой плотности D-центров с неоднородным уширением линии ЭПР.

Список литературы

- [1] Бугай А. А., Зарицкий И. М., Кончиц А. А., Лысенко В. С. // ФТП. 1985. Т. 19. В. 2. С. 257–262.
- [2] Герасименко Н. Н., Двуреченский А. В., Смирнов Л. С. // ФТП. 1971. Т. 5. В. 9. С. 1700–1705.
- [3] Dersch H., Stuke J., Beichler J. // Phys. St. Sol. (b). 1981. V. 105. N 1. P. 265–274. Movaghhar B., Schweitzer L., Overhof H. // Phil. Mag. B. 1978. V. 37. N 6. P. 683–702.
- [4] Абрагам А. Ядерный магнетизм. М., 1963. 551 с.
- [5] Вугмейстер Б. Е., Глинчук М. Д., Кондакова И. В. // ФТП. 1984. Т. 26. В. 2. С. 543–545.

Институт полупроводников АН УССР
Киев

Получено 10.05.1988
Принято к печати 7.12.1988

ФТП, том 23, вып. 5, 1989

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИМЕСИ ХРОМА В ТЕЛЛУРИДЕ СВИНЦА

Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Радченко М. В.,
Колесник С. П., Вертелецкий П. В.

Легирование узкощелевых полупроводников элементами с незаполненными d-оболочками дает возможность исследовать магнитное состояние примесных атомов в матричном кристалле. Такие элементы могут сохранять собственный магнитный момент в диамагнитной матрице. Поэтому, используя чувствительность таких образцов к магнитному полю, можно исследовать состояние примеси в зависимости от концентрации, температуры и условий термообработки.

В настоящей работе изучено влияние хрома на электрические и магнитные свойства PbTe с помощью комплекса методов, включающего исследования магнитной восприимчивости (МВ), коэффициента Холла (R), термоэдс (α), ЭПР.